(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[4]
G03F 1/00

(11) 공개번호 특1985-0004661
(43) 공개일자 1985년07월25일

(21) 출원번호 특1984-0008290
(22) 출원일자 1984년12월14일

(30) 우선권주장 P3346979.2 1983년12월24일 독일(DE)
(71) 출원인 메르크 파텐트 게젤샤프트 미트 베쉬랭크테르 하우프퉁 나우만, 허이만
독일공화국 마르므스타트 디-6100 프랑크푸르테르 스트라세 250
(72) 발명자 빈프리트 바론
독일연방공화국 다르므스타트 디-6100 프랑크푸르테르 스트라세 250
(74) 대리인 유영대, 나영환

심사청구 : 있음

(54) 양성 광저항의 현상액

요약

내용 없음

명세서

[발명의 명칭]

양성 광저항의 현상액

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

바이온 계면활성제를 1-100ppm 함유하는 완층 수용성-알카리 용액을 주성분으로 하는 양성 광저항의 현상액.

청구항 2

제1항에 있어서, 10-60ppm, 바람직하게는 30-50ppm의 계면활성제를 함유하는 현상액.

청구항 3

제1항과 2항에 있어서, 비이온 계면활성제로서 에톡시화 알킬페놀을 함유하는 현상액.

청구항 4

노출된 광저항 코팅을 제1항 내지 3항의 현상액으로 처리하여 양성 광저항 양각 구조를 현상하는 방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.